

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
【部門区分】第7部門第2区分  
【発行日】平成17年8月25日(2005.8.25)

【公開番号】特開2003-282386(P2003-282386A)  
【公開日】平成15年10月3日(2003.10.3)  
【出願番号】特願2002-88153(P2002-88153)  
【国際特許分類第7版】  
H01L 21/02  
【FI】  
H01L 21/02 Z

【手続補正書】  
【提出日】平成17年2月15日(2005.2.15)  
【手続補正1】  
【補正対象書類名】明細書  
【補正対象項目名】特許請求の範囲  
【補正方法】変更  
【補正の内容】  
【特許請求の範囲】  
【請求項1】

半導体デバイス製造プラントにおける複数の処理設備に対して、気体、液体、又は固体からなる同一種類の物質を供給する物質供給システムにおいて、

物質の供給ソースと、

供給ソースからの物質の複数の処理設備への供給を制御する制御装置であって、複数の処理設備で現在使用中の物質の総和が、供給ソースから供給可能な量を超えないように、処理設備での物質の供給開始時点を制御する制御装置とからなることを特徴とする物質供給システム。

【請求項2】

請求項1記載の物質供給システムにおいて、複数の処理設備の少なくとも2つの処理設備は、物質の使用開始を要求するための使用要求信号、又は、使用要求信号及び使用の終了又は終了予告を通知するための使用終了信号を、制御装置に通知するよう構成されており、

制御装置は、少なくとも1つの処理設備が物質を使用中に、該物質に関する使用要求信号を他の処理設備から受け取ったとき、供給ソースからの物質の供給可能量を超えないと判定した場合に、該他の処理設備に物質の使用を可能するための使用許可信号を通知するよう構成されていることを特徴とする物質供給システム。

【請求項3】

半導体デバイス製造プラントにおける複数の処理設備に対して、気体、液体、又は固体からなる同一種類の物質を供給する物質供給システムにおいて、

物質の供給ソースと、

供給ソースからの物質の複数の処理設備への供給を制御する制御装置であって、複数の処理設備で同時に物質が使用されないように、処理設備での物質の使用開始時点を制御する制御装置とからなることを特徴とする物質供給システム。

【請求項4】

請求項3に記載の物質供給システムにおいて、

複数の処理設備の内の少なくとも2つの処理設備は、物質の使用開始を要求するための使用要求信号及び使用の終了又は終了予告を通知するための使用終了信号を、制御装置に

通知するよう構成されており、

制御装置は、少なくとも1つの処理設備が物質を現在使用中のときに、該物質の使用要求信号を他の処理設備から受け取ったときに、使用中の処理設備から使用終了信号を受け取るまで、使用要求信号を発した処理設備に対する物質使用を可能するための使用許可信号の通知を待機するよう構成されている

ことを特徴とする物質供給システム。

【請求項5】

請求項1～4いずれかに記載の物質供給システムにおいて、

物質の供給ソースは、複数の水質グレードの純水を製造する純水製造装置であり、

制御装置は、処理設備への純水供給を、グレード毎に制御するよう構成されている

ことを特徴とする物質供給システム。